图形分析法求半导体激光器端面减反膜的有效反射率

李大义 陈建国 周小红 卢玉村 (四川大学光电系,成都,610064)

摘要:采用图解的方法,对镀制在半导体激光二极管(LD)端面的单层减反射膜的实际效果进行了分析。研究表明:在减反膜的反射率曲线的谱线宽度有限的情况之下,LD 镀膜面上的有效反射率 R_{eff} 一般均高于反射率曲线的最小值 R_{min} ;对 LD 来说,存在着一个最佳波长 λ_{pt} ,当反射率曲线的最小值所处的波长 λ_{f} 与之相等时, R_{eff} 最接近 R_{min} 。

关键词:图形分析 半导体激光器 减反膜 有效反射率

Extracting effective reflectivity at AR coated diode facets using graphical analysis method

Li Dayi, Chen Jianguo, Zhou Xiaohong, Lu Yucun (Department of Optoelectronics, Sichuan University, Chengdu, 610064)

Abstract: In terms of graphical analysis method, the effective reflectivity of antireflection film deposited on the facet of semiconductor laser diode has been studied. The results show, if the spectral width of reflective curve of the antireflective film is finite, the reflectivity is generally greater than the minimum of reflectivity curve. It is possible to minimize the effective reflectivity through carefully choosing the wavelength at which the reflectivity curve reaches its minimum.

Key words: graphical analysis semiconductor laser antireflection coating effective reflectivity

言

引

减反射膜被广泛地用于半导体激光器的端面,以适应外腔式半导体激光器、准行波半导体激光放大器、超发光二极管等的需要。前人的研究表明,当LD端面的反射率被降到很低的时候,反射率对波长的依赖关系将变得不可忽略,反射率曲线的低反射区的谱线宽度不能被当作是无穷大^[1,2]。尽管人们认识到了这一事实,但在多数有关镀减反射膜后的半导体激光器件的研究中,反射率对波长的依赖关系往往被忽略。同时,在许多文献中,干脆就把反射率曲线的最小值 *R*_{min}当作是镀膜端面的实际反射率。面对这种状况,显然有必要在考虑反射率对波长的依赖关系的情况下,对镀制了减反射膜的 LD 端面反射率作进一步的研究。

由于镀制相对方便且易于实现折射率匹配, SiO_x 单层膜被广泛地用来降低 LD 端面的反 射率^[3,4], 其反射率曲线也可以通过比较相同偏置电流下镀膜前和镀膜后同一 LD 输出谱来得 到^[2]。实践表明, 与介质的增益线宽相比, 该反射率曲线的谱线宽度显然是不能被当作无穷 大的。研究表明, 在 LD 一端镀减反射膜之后, LD 中可以建立起的载流子数密度的上限 N_{up} 将比未镀膜时 LD 的阈值载流子数密度 N_V 有明显地提高, 相应于上述载流子数密度的变化, 增益峰值波长也会发生变化^[5]。显然, 图形分析法只要求知道增益峰值波长随载流子密度变 化的规律而不在乎是什么样的规律, 为简便计, 在本文中我们采用了下述近似公式^[5]:

 $\lambda_{e}(N) - \lambda_{e}(N_{ref}) = b(N - N_{ref})$

(1)

式中, $\lambda_{g}(N)$ 和 $\lambda_{g}(N_{ref})$ 分别是当 LD 腔内载流子数密度为 N 和某个参考载流子数密度 N_{ref} 时的增益峰值波长, b 是一个小于零的常数。与增益峰值波长的变化范围相比, 反射率曲线的 谱线宽度也不见得可以看作是无穷大。于是, 在具体的镀膜 LD 中, 实际起作用的反射率可能 会比 R_{min} 大。在本文中, 我们将对广泛使用的一端镀单层减反膜的半导体激光二极管 (ARLD) 进行研究, 考查镀膜端面实际起作用的有效反射率 R_{eff} , 以及在什么情况下 R_{eff} 能够 尽可能地接近反射率曲线的最小值 R_{min} , 即尽可能的发挥减反膜的功效。

从大多数的文献报道来看,目前似乎还很难找到一个简单而普适的解析式来描述 LD 端 面单层减反膜的反射率曲线。从我们以往的实验来看,减反膜的效果也有一定的随机性。因 而,事实上我们研究的出发点将是一个不一定能找到解析表达式的反射率曲线,虽然,该曲线 可以通过比较相同偏置电流下镀膜前和镀膜后同一 LD 输出谱来得到^[2]。针对这种情况,我 们采用了一种图形分析的方法来研究 ARLD。这是一种既不同于计算机数值求解(虽然其结 果常以曲线的形式给出),也不同于常规的解析求解的办法,但在现在这种情况下却是行之有 效的办法。对于给定的反射率曲线,借助图形分析,我们求得了 LD 端面的实际起作用的有效 反射率,了解了如何选择反射率曲线最低反射所处的波长才能使有效反射尽可能的低。

一、一般分析

考虑到减反射膜的反射率(曲线) $R(\lambda)$ 多半是在对数坐标中给出的,因而在形式上我们总可以把这个大于零的数写成 $R(\lambda) = R_{\min} \exp(F(\lambda)]$ (2a) 式中, $\Lambda = \lambda_0$ (2b)

在上边的式子中, λ_0 就是反射率曲线上最小值 R_{\min} 所处的波长(在本文中称为最小波长), F 就是用来描述 R 对波长 λ 的依赖关系的函数。对具体的减反膜, 我们不一定能找到 F 的解析 表达式, 至少在使用图形分析的方法时我们并不需要知道 F 的解析表达式。研究表明^[1,2], 在 我们关心的波长范围内: (1) 反射率曲线只有一个极小值。在数学上意味着: 在 $\Lambda = 0$ 时, F 应 等于零。(2) 当 Λ 的绝对值足够大时, $R(\lambda)$ 随波长的变化将变得非常缓慢, 因而可以近似地 认为在 Λ 为无穷大时, F 趋于某个常数, 亦即 R 趋于 R_i 。顺便提一句, 如果在正负无穷远处 R 的值不同的话, R_i 取其中较大的那一个。

根据自再生条件可以证明, 要想使 ARLD 在波长 λ处满足增益等于损耗, 所需的载流子 数密度 N 就应该满足 N (λ) / {1 + [λ - $\lambda_s(N)$]²} = N_T- F(Λ) / (2aΓL) (3) 式中, $\lambda_s(N)$ 是当 LD 中载流子数密度等于 N 时的增益峰值波长, a 是微分增益系数, Γ 是限 制因子, L 是 LD 的腔长, 且 N_T = N₀ + [2 × L - ln($R_{min}R_0$) / (2aΓL) (4) 式中, N₀ 为透明载流子密度, × 为损耗系数, R₀ 是 LD 未镀膜端面的反射率。

参量 N_T 表示出了要克服端面反射率分别为 R_{min} 和 R_0 的 ARLD 的各种损耗所需的载流 子密度(如果该 ARLD 能振荡的话,就是阈值)。从(3)式可以看到, LD 的增益线型已用洛伦 兹函数来描述; 同时,为了计算方便,波长已经被归一化到表征增益线宽的因子 Q(在洛伦兹 函数的情况下,线宽等于 2Q)。类似地,我们还可以定义另外两个有用的参量 N v 和Nv,它们 分别是把(4)式中的 R_{min} 用 R_i 和 R_0 来代替而得到的。显然, Nv就是镀膜之前 LD 的阈值载 流子数密度。

一般而言,半导体激光器表现为均匀加宽,因而并非凡是能满足(3)式的 N 就能存在于

ARLD 中。在任何实际的 ARLD 中, 可能存在的载流子密度上限 N_{up} 只能是满足(3) 式的所有 的 N 中最小的那一个。实验表明, 在不少的一面镀减反膜的 LD 的功率 电流(即 P-I) 曲线上 还可以观察到阈值特征, 不过, 与未镀膜的 LD 的 P-I 曲线相比, ARLD 的功率转折已明显变 缓^[7]。对这种呈现阈值特征的 ARLD, 其 N_{up} 可由相应的阈值电流来确定。对于那些镀减反 膜后不再呈现阈值特征的 ARLD, N_{up} 则表示一个载流子数密度不能逾越的界线而已。

二、图形分析

由于(3)式两端的量纲与载流子数密度相同(为方便计,本文中分别称为增益和损耗),因 而图形分析可以在 *N*-X(即载流子数密度 波长)平面内进行。由于反射率曲线多在对数坐标 中给出的,因而它与载流子数密度有线性关系,故而图形分析也可以在 *R*-X(反射率 波长)平 面内进行。

在进行图形分析之前,我们对半导体激光二极管进行了相应的实验研究,获得了如下的信息。通过比较 LD 单面镀膜前和镀膜后在 26mA 电流下的发射谱,按文献[2]介绍的方法测得 了减反膜的反射率曲线。通过比较未镀膜 LD 在几个电流下的发射谱,测得(1)式中的参量 b为-3.3×10⁻¹⁹cm³, Q 约为 30nm。此外,镀膜前 LD 阈值电流 ($_V$ 以及振荡波长与最小波长的差($\lambda_V - \lambda_0$)分别为 26.5mA 和 1.8nm;镀膜后的 ARLD 阈值电流 I_{th} 以及振荡波长与最小 波长的差($\lambda_h - \lambda_0$)分别为 55mA 和 - 13.2nm。在本文中,我们用下式由电流来确定载流子数 密度的测量值 $I/(eV) = AN + BV^2 + CN^3$ (5)

式中, *e* 为电子电荷(绝对值),有源层体积 $V = 2.8 \times 10^{-10}$ cm³,无辐射俘获系数 *A*,辐射复合系数 *B* 和俄歇系数 *C* 分别为 $5 \times 10^{7} \text{s}^{-1}$, 1×10^{-10} cm³/s, 3×10^{-29} cm⁶/s。于是,根据测得的镀膜前后的阈值电流,由(5)式可知 N_V 的测量值为 1. 8×10^{18} cm⁻³ N_{up} 的测量值约为 2. 5×10^{18} cm⁻³。从后边(6)式所定义的等效反射率可知 ARLD 的有效反射率的测量值约为 2. 9×10^{-3} 。

在图 1 中, 我们画出了 $N-\lambda$ (或 $R-\lambda$) 平面以及示意 性给出如何用图解法求参量 N_{up} , λ_{th} 等。在图中可以看 到一条连接实测值而得到的反射率曲线(实线), 用比较 法^[2]测得的不同波长处的反射率由图中的实心圆点给 出。在建立反射率与载流子数密度这两个纵坐标之间的





对应关系时,可以直接在 R_{\min} , R_i 和 R_V 的地方标上 N_T , N_U 和 N_V 。为了获得上述载流子数 密度的具体值, 在本文中使用了如下的数据: $N_0 = 1 \times 10^{18}$ cm⁻³, $a\Gamma = 7.5 \times 10^{-17}$ cm², Y = 25 cm⁻¹, L = 0.035 cm。据此, 由(4) 式可以算出 N_T 和 N_V 分别为 3.5×10^{18} cm⁻³ 和 1.8×10^{18} cm⁻³。在获知反射率曲线的情况下, 作图步骤大致如下: 1. 确定线 TV: 根据未镀膜 LD 的振 荡波长 λ_V 在图上找到 V 点, 该点的纵坐标为 $R_0(\mathbb{D} \ 0.3)$, 与之对应的载流子数密度 N_V 可由 把测量得到的阈值电流代入(5) 式来确定。作为最基本的要求, 它应与从(4) 式算出的 N_V 相 等。找到了 V 点后, 利用测得的参量 b, 按(1) 式画直线, 它与表示 R_{\min} 和 R_i 的水平线分别交 于 T 和 U 两点, 与之相对应的载流子数密度可用(4) 式算出。2. 作出高度为 N 的增益(即洛 伦兹) 曲线, 这些曲线的顶点应保持在直线 TUV 上。在这些曲线中要找到一条与反射率曲线

(6)

相切的曲线(如图 1 中的虚线所示)。假设该洛伦兹曲线的顶点为 W(其对应坐标为 N_W 和 λ_W),它与反射率曲线之间的切点为 X(该处的波长为 λ_X)。于是,我们就用图解法求得了 ARLD的载流子数密度上限 $N_{up}(=N_W)$,如果这个 ARLD 能振荡的话,其振荡波长 λ_h 应等于 $\lambda_X($ 它与增益峰值波长 λ_W 不一定相同)。为了定量描述 ARLD 端面减反膜的实际效果,我们 根据在 ARLD 内实际上可以建立的最大载流子数密度 N_w 按下式引入了一个有效反射率 R_{eff}

 $R_{\text{eff}} R_{0} \exp\{2L \left[a \Gamma(N_{\text{up}} - N_{0}) - Y \right] = 1$

上式表明, 虽然减反射膜的最小反射率 R_{min} 可以很小, 但在具体的 ARLD 上, 其效果与反射率 为 R_{eff} 的宽谱线减反射膜差不多。由于 N_{up} 通常是小于 N_T 的, 因而有效反射通常是大于反射 率曲线上的最小值 R_{min} 的。由图形分析, 可求得在图 1 中所使用的 ARLD 的 R_{eff} 约等于 3× 10^{-3} , N_{up} 略小于 2. 5× 10^{18} cm⁻³, 振荡波长比 λ_0 短 0. 4(对应 12. 1nm)。而上述的几个参量的 实验值分别为 2. 5× 10^{18} cm⁻³, 2. 9× 10^{-3} 和 0. 44(对应 13. 2nm)。看来, 图形分析的预计与实 验测得的结果基本上是一致的。

在单层减反膜的镀膜过程中,要精确控制 λ_0 并不容易,即使采用生动监控的办法也不见 得十分理想^[3]。这将使得在实际的 ARLD 中,参量 Λ_T 或($\lambda_T - \lambda_0$)有一些不确定。在应用图 形分析的时侯,这种不确定性将表现为图 1 中的反射率曲线与线段 *TUV* 之间有一个相对移 动。从图 1 可以看到:(1)当 Λ_T 等于很大的负数时,反射率曲线负半支的尾部将与 *TV* 相交。 可以证明,过交点的增益曲线在交点波长处是满足增益等于损耗的。换句话说,ARLD 的载流 子数密度上限不能大于交点所对应的载流子数密度的。可见,如果最小波长控制不好,ARLD 的有效反射率接近 R_i 。在 Λ_T 趋于正无穷大时,情况亦类似。(2)在 Λ_T 处于某个范围内时, 曲线 *TV* 可能低于反射率曲线的正半支而与负半支相交(设交点为 *W*1)。可以证明,在交点 对应的波长处,以交点为顶点的增益等于损耗。同时根据图形的特点还可看到,以交点为顶点 的洛伦兹线还会与反射率曲线负半支的尾部相交。总之,在这两个交点所在的波长处,满足增 益等于损耗所需的载流子数密度是相同的。在这种情况下,我们可以在 *W*1V 之间靠近 *W*1 的地方选择另外一个点 *W*4。如果以 *W*2 为顶点的增益曲线与反射率曲线还有两个交点的 话,可以重复上边的过程,直到找到点 *W*。以 *W* 为顶点的增益曲线与反射率曲线相切于*X*。 于是 *W* 所代表的载流子数密度和波长就是 *N*40

切点代表的波长就是它的振荡波长。此时就可能 会出现 ARLD 的振荡波长与峰值波长不等的现 象。(3)在 Λ_T 由小变到大的过程中, 当变到某个 最佳波长(本文中记为 Λ_{opt})处, 载流子数密度上 限将达到某个最大值 N_{opt} 。此时, ARLD 端面的 有效反射率 R_{eft} 将达最佳值 R_{opt} 。在镀制减反射 膜的时侯, 应该让($\lambda_T - \lambda_0$)等于 Λ_{opt} , 这样才能 使减反膜发挥最大的功效。在采用主动监控 法^[8] 镀制减反膜时, 可选择合适的偏置电流, 使 LD 在该电流下的载流子数密度大致等于 N_{opt} , 从而镀制出来的减反膜具有较低的有效反射率。



Fig. 2 Graphical analysis predicted dependences of R_{eff} and λ_{th} on $(\lambda_T - \lambda_0)$ or Λ_T

在图 2 中,我们画出了由图解法求得的有效反射率和($\lambda_{h} = \lambda_{0}$) 随($\lambda_{T} = \lambda_{0}$) 或 Λ_{T} 变化的

高光束质量磷酸盐钕玻璃板条多程放大系统的研究*

吕百达 邵怀宗 冯国英 罗时荣 蔡邦维 (四川大学激光物理与化学研究所,成都,610064)

摘要:建立了磷酸盐钕玻璃布儒斯特角板条激光振荡-多程放大系统,其中,提出了用两棱镜 折返光路的新型三程放大器,用 Cr⁴⁺:YAG 色心晶体作为被动 Q 开关。实验得到高光束质量(M_x^2 = 1.49 和 M_y^2 = 1.57)和能量增益为 23 的激光脉冲输出。实验数据与数值计算结果比较,符合得 较好。

关键词: 磷酸盐钕玻璃板条 多程放大器 光束质量

Study of phosphate Nd glass slab multipass amplifier system with high beam quality

L Baida, Shao Huaizong, Feng Guoying, Luo Shirong, Cai Bangwei (Institute of Laser Physics & Chemistry, Sichuan University, Chengdu, 610064)

Abstract: A phosphate Nd glass Brewster angled slab oscillator and multipass amplifier system has been built up, where a novel three pass amplifier with two prisms has been proposed and a Cr^{4+} : YAG colour center crystal has been used as the passive Q switcher. In our experiment the output with high beam quality of $M_x^2 = 1.49$ and $M_y^2 = 1.57$ and with an energy gain of 23 has been achived. The experimental data have been compared with the numerical calculation results, showing a good consistency.

Key words: phoshate Nd glass slab multipass amplifier beam quality

* 国家高技术惯性约束聚变主题资助

关系曲线。除了 λ_0 与 λ_0 的相对关系在不断变化之外,求解时使用的反射率曲线与图 1 相同。 图中两个实心圆点是实验测得的数据。从图中可以看到最佳波长 Δ_{opt} 的存在。

我们曾假想反射率曲线可以用不太复杂的解析函数来描述,然后用计算机进行计算;同时,在计算中也曾使用过好几种函数。计算结果表明,图形分析对 ARLD 的主要特征所作的预测,在用假象曲线进行的计算中都得到了反映。

参考文献

- 1 Eisenstein G, Raybon G, Stulz L. W. IEEE Lightwave Technol, 1988; 6(1): 12~15
- 2 Luo B, Wu L, Chen J et al. IEEE Photonics Technol Lett, 1993; 5(11): 1279~ 1281
- 3 Olsson N A, Oberg M G, Tzang L D et al. Electron Lett, 1988; 24(9): 569~ 570
- 4 Saitoh T, Mukai T, Mikami O. IEEE Lightwave Technol, 1985; 3(2): 288~293
- 5 Wang J, Chen J, Hao Y et al. IEEE Photonics Technol Lett, 1993; 5(10): 1171~1173
- 6 Vassalo C. Eletron Lett, 1988; 24(1): 61~ 62
- 7 Dutta N K, Deimel P P. IEEE Quantum Electron, 1983; 19(4): 496~498

作者简介:李大义,男,1940年6月出生。副教授。现从事光纤通信及非线性光学方面的科研和教学工作。

收稿日期: 1997-10-30 收到修改稿日期: 1998-01-18